

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 5 月 21 日 (2009.5.21)

【公開番号】特開 2008-124111 (P2008-124111A)

【公開日】平成 20 年 5 月 29 日 (2008.5.29)

【年通号数】公開・登録公報 2008-021

【出願番号】特願 2006-303676 (P2006-303676)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

C 2 3 C 16/505 (2006.01)

C 2 3 C 16/52 (2006.01)

C 2 3 C 16/24 (2006.01)

H 0 1 L 31/04 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/205

C 2 3 C 16/505

C 2 3 C 16/52

C 2 3 C 16/24

H 0 1 L 31/04 X

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 4 月 6 日 (2009.4.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 8 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 8 1】

また、形成されたシリコン薄膜の結晶化度 (I c / I a) の測定結果と成膜時のプラズマポテンシャルとの関係を図 5 に示す。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 0 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 0 1】

- 1 成膜室
- 1 1 成膜室 1 の天井壁
- 1 1 1 天井壁 1 1 に設けた電気絶縁性部材
- 2 基板ホルダ
- 2 1 ヒータ
- 3 誘導結合型アンテナ
- 3 1、3 2 アンテナ 3 の端部
- 4 高周波電源
- 4 1 マッチングボックス
- 5 排気ポンプ
- 5 1 コンダクタンスバルブ
- 6 成膜原料ガス供給部
- 7 希釈ガス供給部

- 8 終端処理用ガス供給部
- 1 0 プラズマ診断装置
- 1 0 a ラングミュアープローブ
- 1 0 b プラズマ診断部
- 1 0 0 圧力計